



## 報道発表

2014年9月8日

報道関係各位

### 田中喜男氏が D2S 社にヴァイスプレジデントとして参加 －日本での新規事業開拓を加速－

半導体フォトマスク製造に対するマスクデータ準備(MDP)ソフトウェアなど複数のフォトマスク関連ソフトウェア製品を提供するシリコンバレー企業である D2S<sup>®</sup>, Inc. (本社：米国加州サンノゼ市) は、9月1日付けでヴァイスプレジデントとして田中喜男氏が就任したことを本日発表しました。田中喜男氏は KLA テンコールジャパン社、ニューメリカルテクノロジー社等の GM や役員を歴任し、前職ではルミネセント社(Luminescent Technologies, Inc.)のVP 日本支社長として日本での新規事業開拓をリード、半導体露光およびフォトマスク関連業界における新規事業開拓と経営者としての長年にわたる経験と実績を有しています。D2S ではこの経験を生かして、日本が世界に誇る半導体フォトマスクメーカーやフォトマスク関連装置メーカーとの関係を強化、日本市場での事業拡大を目指します。

D2S はパターンが複雑化するマスクの製造に対し、既存 eBeam 技術を最大限に利用する形で、より高精度に、かつ、現実的な描画時間でマスク製造を可能とする TrueMask<sup>®</sup> MDP や、マスク製造における多様な解析要求に応える TrueMask DS などの製品を提供しています。

#### 田中喜男氏の略歴

- 1969年3月 京都大学電子工学科卒業
- 1969年4月～ 沖電気工業株式会社入社  
電子ビーム描画技術によるフォトマスク量産製造技術開発
- 1996年2月～ KLA テンコール株式会社、ラピッドビジネスユニット責任者
- 2001年2月～ ニューメリカルテクノロジー インコーポレーテッド VP
- 2002年10月～ 日本シノプシス合同会社 ディレクター マニュファクチュアリング
- 2007年2月～ ルミネセントテクノロジーズ インコーポレーテッド VP 日本支社長

#### Aki Fujimura 氏 (D2S Inc. Chairman 兼 CEO)

「日本の半導体フォトマスク業界の著名人である田中氏を D2S に迎えることができ大変喜んでおります。田中氏は革新的技術や製品の日本での新規事業開拓にて経験と実績のあることから、当社の Model-based MDP 製品である TrueMask MDP のマスク製造前工程への適用や高速・高精度露光シミュレーション製品を一機能として持つ TrueMask DS の各種マスク検査装置との連携とマスク製造後工程への適用など、当社が現在進めております新規事業開拓に関し、田中氏が参加する事でさらに強力に押し進めて行けると期待しております」

-more-

田中喜男氏（D2S ヴァイスプレジデント 新規事業開拓 日本担当、株式会社 D2S 取締役）

「20nm 以降の最先端半導体の製造が量産に近づくに従い、大きく減少したプロセスマージンの問題への早急な対処が求められるようになっております。そのため、複雑なマスクパターンを高精度にかつ安定に形成する必要性はますます増大しており、TrueMask MDP や TrueMask DS など D2S の持つ数々の先端ソリューションはこの要求に大いに役立つと確信しております。今回 D2S のチームに参加することで、皆様の事業の発展に大いに寄与したいと考えております。」

#### **D2S (Design to Silicon) について：**

D2S は既存 eBeam 技術を最大限に利用し、少量生産および大量生産に対するマスク製造コストを削減するためのコンピュータベースの設計プラットフォームを供給するメーカーです。D2S TrueMask® ソリューションは、ウエハ高品質確保のために必要とされる複雑な形状を、既存の eBeam マスク描画装置を利用し、コスト効果高い描画時間で、28nm もしくはそれ以降の世代の先端フォトマスクの製造を可能とする製品です。D2S は eBeam Initiative の事務局を担っています。本社はカリフォルニア州サンノゼ市にあり、2007 年に創業しております。詳細に関しましては、：[www.design2silicon.com](http://www.design2silicon.com) を参照ください。

本件に関するお問い合わせ先：

**株式会社 D2S**

立石正博（代表取締役社長）

Tel: 045-479-8390(代)

E-mail: [info@design2silicon.com](mailto:info@design2silicon.com)

*D2S と D2S のロゴ、TrueMask は、D2S, Inc. の登録商標です。本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。*